

(43) 国際公開日
2008年3月27日 (27.03.2008)

PCT

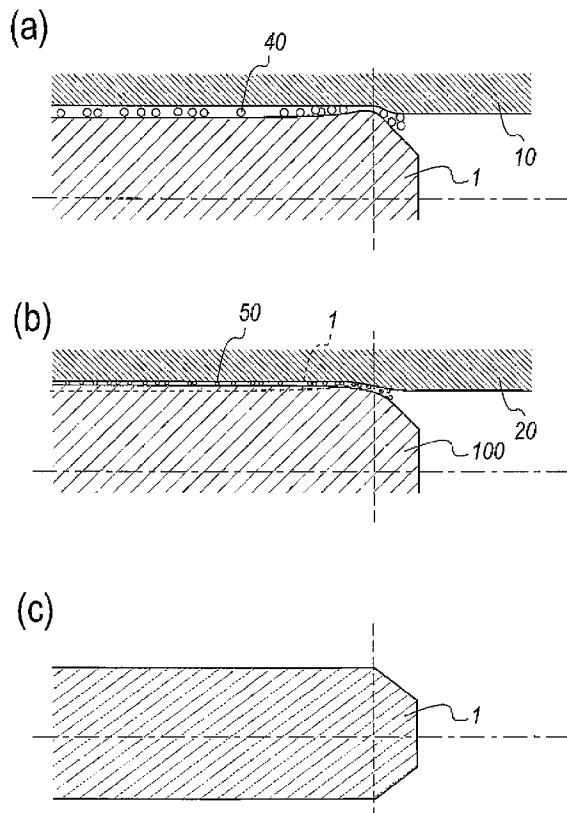
(10) 国際公開番号
WO 2008/035586 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 9/08 (2006.01) B24B 37/00 (2006.01)
B24B 1/00 (2006.01) G11B 5/84 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2007/067619
- (22) 国際出願日: 2007年9月11日 (11.09.2007)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2006-253571 2006年9月19日 (19.09.2006) JP
特願2006-253572 2006年9月19日 (19.09.2006) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): HOYA株式会社 (HOYA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 片桐 誠宏 (KATA-GIRI, Masahiro) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 HOYA株式会社内 Tokyo (JP). 吉
- (74) 代理人: 池田 憲保, 外 (IKEDA, Noriyasu et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋1丁目4番10号 第三森ビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING GLASS SUBSTRATE FOR MAGNETIC DISK AND PROCESS FOR MANUFACTURING MAGNETIC DISK

(54) 発明の名称: 磁気ディスク用ガラス基板の製造方法および磁気ディスク製造方法



(57) Abstract: In the anterior grinding step wherein under the supply of a grinding fluid containing grind abrasive grains of large diameter, a glass substrate and a soft grind pad are moved in relative relationship so as to achieve grinding, there occurs a morphology such that edges of major surface of the glass substrate protrude relative to the central part thereof (ski jump). Thus, in the posterior grind step, using a grinding fluid containing grind abrasive grains of small diameter and a grind pad harder than the above grind pad, there is performed grinding such that if a glass substrate with flat edge portions were ground, a glass substrate whose edge portions of the major surface descend relative to the central part thereof (roll off) would be obtained. As a result, the glass substrate can be modified toward cancellation of the ski jump generated in the anterior grinding step, so that the configuration of the edge portions would approach flatness.

(57) 要約: 粒径の大きい研磨砥粒を含有する研磨液を供給しながら、ガラス基板と軟質の研磨パッドとを相対的に移動させて研磨を行う先行研磨工程では、ガラス基板の主表面の端部が中央部と比べて隆起する形状 (スキージャンプ) が生じる。後続研磨工程では、粒径の小さい研磨砥粒を含有する研磨液と、研磨パッドより硬度の高い研磨パッドとを用い、仮に平坦な端部を有するガラス基板を研磨すれば主表面の端部が中央部と比べて下降する形状 (ロールオフ) のガラス基板が得られる研磨を行う。これにより、ガラス基板を、先行研磨工程で発生したスキージャンプを相殺する方向に変化させ、端部形状を平坦に近づける。

WO 2008/035586 A1



SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書